

会場：パシフィコ横浜 アネックスホール（横浜市みなとみらい）

会期：2025年4月17日（木）10:00-17:00 / 18日（金）10:00-16:00

Venue: Pacifico Yokohama (Annex Hall)

Date & Time: April 17 (Thu.) 10:00-17:00, 18 (Fri.) 10:00-16:00

主催：ホトマスクジャパン (PMJ) / SPIE

Organized by : Photomask Japan / SPIE

共催：BACUS / EMLC

Co-Organized by : BACUS / EMLC

協賛：SEMI ジャパン

Sponsored by : SEMI Japan

主な出展製品

- ホトマスク ●マスク部材 ●レジスト ●EUVL 関連
- 製造装置 ●検査装置 ●修正装置 ●試験／測定装置
- 洗浄装置 ●CAD データ処理 ●シミュレーション
- 出版・サービス

※ 研究・開発、設計、技術、生産・製造、経営・管理に携わる専門家、購買・調達ご担当者に最新技術を提供します。

出展社（五十音順）

(株)アストロン	日本ガイシ(株)
(株)アドバンテスト	日本コントロールシステム(株)
アプライドマテリアルズ / シグマメルテック (株)	日本シノプシス (同)
RI Research Instruments GmbH	日本電子(株)
稲畑産業(株)	(株)ニューフレアテクノロジー
(株)エイチ・ティー・エル	ノードソン テスト&インスペクション アメリカ
(株)オータマ	ハイデルベルグ・インストルメンツ(株)
カールツァイス(株)	浜松ホトニクス(株)
キャノンマーケティングジャパン(株)	ヒューグルエレクトロニクス(株)
Greateyes GmbH	(株)フィジックステクノロジー
Gudeng Precision Industrial Co., LTD	ブルカージャパン(株)
ケイエルブイ(株)	(株)堀場製作所
(株)ジーダット	(株)ホロン
芝浦メカトロニクス(株)	マイクロニックテクノロジーズ(株)
ズース	松下精機(株)
(株)ダン・タクマ	リソテックジャパン(株)
TOOL (株)	レーザーテック(株)
	列真(株)

MAIN EXHIBITS

- Photomask ●Material ●Resist ●EUVL
- Manufacturing ●Inspection ●Repair
- Metrology/Testing ●Cleaning ●CAD Data Process
- Simulation ●Publication/Service

※ TECHNICAL EXHIBITION provides the latest technologies to all people in research & development, design, engineering, production & manufacturing, general management, and purchasing & procurement in mask industry.

EXHIBITORS (in alphabetical order)

ADVANTEST CORPORATION	KLV Co., Ltd.
Applied Materials, Inc. / Sigmameltec Ltd.	Lasertec Corporation
ASTRON, Inc.	LAZIN Co.,Ltd,
Bruker Japan K. K.	Litho Tech Japan Corporation
Canon Marketing Japan Inc.	MATSUSHITA SEIKI CO., LTD.
Carl Zeiss Co., Ltd.	Mycronic Technologies Corporation
Dan-Takuma Co., Ltd.	NGK INSULATORS, LTD
Greateyes GmbH	Nihon Synopsys G.K.
Gudeng Precision Industrial Co., LTD	Nippon Control System Corporation
HAMAMATSU PHOTONICS K.K.	Nordson Test and Inspection Americas, Inc
Heidelberg Instruments KK	NuFlare Technology, Inc.
HOLON CO., LTD.	OHTAMA CO., LTD.
HORIBA, Ltd.	Physix Technology Inc
HTL Co. Japan Ltd.	RI Research Instruments GmbH
Hugle Electronics Inc.	Shibaura Mechatronics Corporation
INABATA & CO.,LTD.	SUSS
Jedat Inc.	TOOL Corporation
JEOL Ltd.	

展示会に参加される方は、フォームよりご登録ください。展示会は参加費無料です。

Please register for the Exhibition via the registration form. Admission Free for Exhibition.



4月16日(水) -18日(金)
パシフィコ横浜 (アネックスホール)

主催: ホトマスクジャパン (PMJ) / SPIE

共催: BACUS / EMLC

後援: 横浜市

参加費: **65,000円 (SPIE 会員) / 70,000円**

※4/2 まで早期割引: 60,000円 (SPIE 会員) / 65,000円

※4月16日 Session3 13:45-14:55 のみ参加の場合
12,000円 (早期割引 10,000円)

April 16 (Wed.) -18 (Fri.)

Pacifico Yokohama (Annex Hall)

Organized by : Photomask Japan / SPIE

Co-Organized by : BACUS / EMLC

Sponsored by : City of Yokohama

Registration fee : 65,000 JPY(SPIE Member)/70,000 JPY

※Pre-registration by April 2: 60,000 JPY(SPIE Member)/65,000 JPY

※Session3 ONLY April 16, 13:45-14:55 : 12,000 JPY
(Early-bird:10,000 JPY)



Registration ➡ <https://smartconf.jp/content/pmj2025>

Symposium Program

The program is based on commitments received by the time of publication and is subject to change without notice.

April 16 (Wed.)	April 17 (Thu.)		April 18 (Fri.)
9:00 - 9:10 Opening	9:00 - 10:35 Session 6	9:00 - 10:35 Session 7	9:00 - 9:50 Session 13
9:10 - 11:15 Session 1 Opening Session Day1 Keynote & Mask Patterning with material	Opening Session Day 2 Keynote & MDP	Opening Session Day 2 Defect, Handling, Analysis and Pellicle	Opening Session Day 3 Keynote & mask writer and inspection /metrology to deliver quality content
11:15 - 11:35 Break	10:35 - 10:55 Break	10:35 - 10:55 Break	9:50 - 10:10 Break
11:35 - 12:35 Session 2 Keynote & Energy Sustainability and Productivity	10:55 - 11:55 Session 8 Mask Metrology	10:55 - 11:45 Session 9 Resist related technologies	10:10 - 11:25 Session 14 Mask blanks
12:35 - 13:55 Lunch Break	11:55 - 13:25 Lunch Break	11:45 - 13:25 Lunch Break	11:25 - 12:35 Lunch Break
13:55 - 15:05 Session 3 Large size panel technology	13:25 - 14:45 Session 10 Mask Inspection	13:25 - 14:50 Session 11 NIL	12:35 - 13:40 Session 15 Mask Patterning 2
15:05 - 15:25 Break	14:45 - 15:00 Break		13:40 - 14:00 Break
15:25 - 16:30 Session 4 Mask Patterning 1	15:00 - 16:20 Session 12 Poster Session		14:00 - 14:45 Session 16 Laser Mask Writing Technology
16:30 - 16:50 Break	16:20 - 16:40 Break		14:45 - 15:05 Break
16:50 - 18:25 Session 5 Mask repair	16:40 - 18:10		15:05 - 16:25 Session 17 EB Mask Writing Technology
	Panel Discussion		16:25 - 16:35 Closing
	18:30 - 20:30 Banquet		
	10:00 - 17:00 Technical Exhibition		10:00 - 16:00 Technical Exhibition



Venue Information

パシフィコ横浜
PACIFICO Yokohama

<https://www.pacifico.co.jp>



Access to the Venue

- ・みなとみらい駅から徒歩 5分
- ・桜木町駅から徒歩 12分
- ・5min. walk from Minato Mirai Station
- ・12min. walk from Sakuragicho Station.

お問合せ Photomask Japan 事務局 (株) PCO 内
Photomask Japan Secretariat c/o PCO Co., Ltd.

TEL: 076-471-0744 E-mail: pmj@pcojapan.jp <https://smartconf.jp/content/pmj2025>

